

洗浄装置・オゾン水生成機器販売

洗浄装置 用途▶ 半導体ウエハ(SiC,GaN,シリコン,サファイア等),MEMS

特徴

枚葉式の極めて優れた性能を届けます

パーティクル数が
極めて少ない
(ウエハ表面上)

純水・薬液
使用量が少ない

純水…0.5リットル (1枚当り)
薬液…20リットル (1日当り)

驚きの低価格

コンパクトな装置サイズ

〈処理本体〉
幅 1100mm/奥行き 800mm/高さ 1900mm
〈薬液供給本体〉
幅 500mm/奥行き 800mm/高さ 1800mm



装置全体



2流体ジェット



操作画面

精密洗浄用オゾン水生成機器 用途▶ 半導体(SiC,GaN,シリコン,サファイア等),液晶,MEMS,太陽電池,医療



特徴

高オゾン濃度

最大 30ppm

金属コンタミ無し

接液部・接ガス部は
石英と樹脂のみ

オゾン濃度の
立上がり早い

2分以内で最大濃度到達

コンパクトサイズ

幅 400mm/奥行き 550mm/高さ 800mm